

Method of normalization of the contour line in thickness based on binary masks

Shauchuk A. G. ¹,

Tsviatkou V. Yu. ²

2017 г.

Department of Info Communication Technologies, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk, Belarus

Keywords: Normalization of the contour lines in thickness, the mask analysis, thinning.

Abstract: We propose a method of normalization in thickness of the contour lines based on the analysis by mask of the local orientations of fragments. Comparison of the proposed method with known methods of thinning is held. It is shown that the proposed method is superior to the known methods of thinning on speed and quality.

Published in: 2016 Al-Sadeq International Conference on Multidisciplinary in IT and Communication Science and Applications (AIC-MITCSA) (IEEE Conference Publications), 9-10 May. – 2016. – 6 pp.

Метод нормализации контурных линий на основе бинарных масок

Шевчук О. Г. ¹,

Цветков В. Ю. ²

2017 г.

Кафедра инфокоммуникационных технологий, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Ключевые слова: Нормализация контурных линий по толщине, масочный анализ, скелетизация.

Аннотация: Предложен метод нормализации двухконцевых контурных линий по толщине для бинарных изображений, основанный на масочном анализе локальных ориентаций их фрагментов. Произведено сравнение предложенного метода с известными методами скелетизации. Показано, что предложенный метод превосходит известные методы скелетизации по быстродействию и качеству.

Источник публикации: Conference on Multidisciplinary in IT and Communication Science and Applications (AIC-MITCSA) (IEEE Conference Publications), 9-10 May. – 2016. – 6 pp.